

WAFER

Descripción: Horno de laboratorio con tecnología combinada de microondas y calor radiante para calentamiento de obleas de semiconductor.

Ventajas:

- Calentamiento combinado microondas-infrarrojos.
- Capacidad de experimentación con los diferentes regímenes potencia/tiempo.
- Rápida capacidad de respuesta uniforme.
- Reducción de los costes energéticos.
- Medida de temperaturas en el interior de la muestra mediante FO.

Especificaciones:

- Temperatura máxima: 1.200 °C
- Volumen de trabajo: 40x40x30 cm
- Unidad de microondas: 1 kW @ 2,45 GHz
- Alimentación: 230 V_{AC} 50 Hz
- Consumo: 1500 W
- Atmósfera: oxígeno/yodo (introducido desde el exterior)
- Potencia de microondas variable en saltos de 100 W.
- Medida de T^a: 2 sondas FO
- Pantalla táctil en color de 5" con control de POTENCIA/TIEMPO, STIRRER ON/OFF para programación sencilla de las aplicaciones.



Fotografías orientativas, no contractual

Le invitamos a visitar nuestra página WEB: www.apliquem.com donde podrá conocer nuestros productos que llevamos
Si tiene alguna duda envíenos un correo a la dirección: sopORTE@apliquem.com